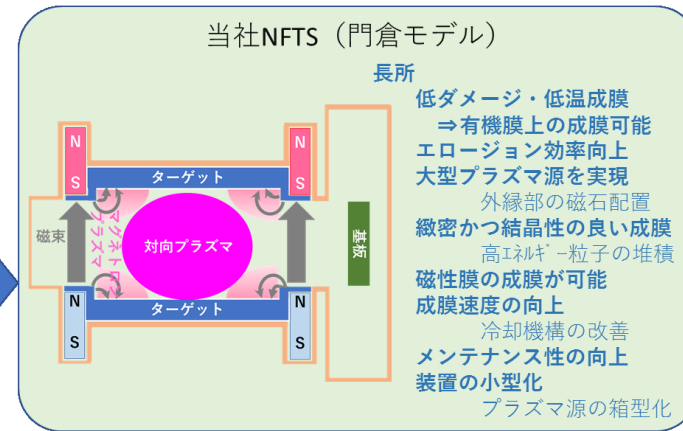
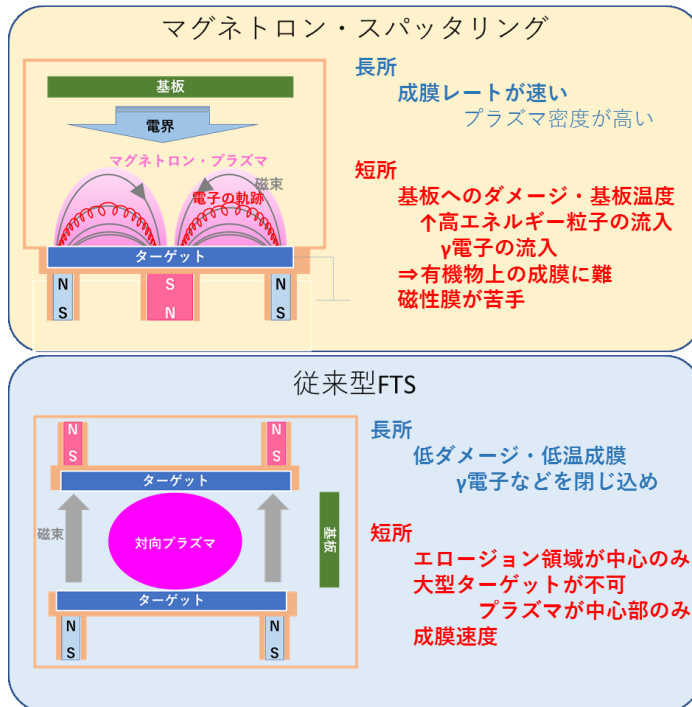


新対向ターゲット式スパッタ装置 (NFTS)

新対向ターゲット式スパッタ (New Facing Targets Sputtering : NFTS) 技術は高密度プラズマを箱型空間に拘束することにより、堆積基板へのエネルギー種 (反跳粒子、イオン、電子) の衝撃によるダメージを抑制できる原理・構造を特徴とする成膜技術です。

NFTS技術により、これまでのスパッタ技術では困難とされていた低温・低ダメージで高品質な薄膜を形成することができ、かつ高い生産性を有する成膜技術となっています。また、NFTS技術により形成される薄膜は従来のスパッタ技術により形成される薄膜と比較し、粒子界面に空隙の少ない緻密な膜を形成することができます。また箱型プラズマ源の開発により、次世代新材料・デバイスの研究開発用の小型実験装置から量産用の大型装置まで幅広く対応することが可能となりました。



NFTS用途

- ◆ プラスチックフィルムコーティング分野
- ◆ 有機薄膜応用分野
- ◆ 多層光学薄膜応用分野
- ◆ 各種パッシベーション膜分野
- ◆ 半導体デバイス応用分野
- ◆ 磁性薄膜応用分野
- ◆ 超伝導薄膜応用分野
- ◆ MEMS 応用分野



▲ 高性能透明断熱フィルム